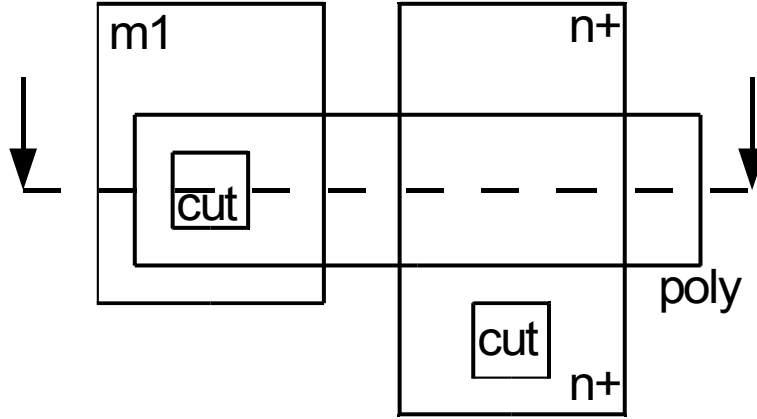


### EEM411 DERSİ 1. KISASINAV SORULARI

1. CMOS üretim sürecinde MOSFET'lerin drain ve source bölgelerinin oluşumunda etkin olan maske hangisidir? **ACTIVE**
2. MOSFET kanal uzunluğu (L) hangi maske ile belirlenir? **POLY**
3. MOSFET substrate oluşumu hangi maske ile belirlenir? **WELL**
4. CMOS üretim sürecinde GateOxide uygulaması sonrası hangi maske uygulanır? **POLY**
5. CMOS üretim sürecinde belirli bölgelerdeki Oxit tabakasının X-Maskesi ile kaldırılması isteniyor. Uygulanacak işlemleri sırasıyla yazınız.  
**Fotoresist kapla, X-Mask yerleştir, UV light uygula, fotoresist develop et, asit ile erit, fotoresist kaldır/erit.**
6. Aşağıdaki serimde belirtilen kesit çizgisine göre serimin kesit çizimini yapınız.



Aşağıdadır:

